

## Учебный план\*

по программе «Аппаратчик-подслойщик фотостекла»

| № п/п   | Наименование модуля                                       | Академических часов |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Тема 1  | Основы химии для химико-фотографического производства     | 6ч                  |
| Тема 2  | Основы физики и электротехники в технологическом процессе | 8ч                  |
| Тема 3  | Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность   | 8ч                  |
| Тема 4  | Основы метрологии и контроля качества                     | 8ч                  |
| Тема 5  | Оборудование и автоматизация производства                 | 8ч                  |
| Тема 6  | Технология химической очистки фотостекла                  | 8ч                  |
| Тема 7  | Нанесение подслоёв на фотостекло                          | 8ч                  |
| Тема 8  | Противоореольные слои: составы и методы нанесения         | 4ч                  |
| Тема 9  | Регулировка технологических режимов                       | 2ч                  |
| Тема 10 | Дефекты обработки фотостекла и способы их устранения      | 2ч                  |
| Тема 11 | Практикум по работе на автоматической линии               | 2ч                  |
|         | Практические занятия                                      | 96ч                 |
|         | <b>ИТОГО:</b>                                             | <b>160ч</b>         |



Утверждаю  
Директор ООО МПЦ «Феникс» \_\_\_\_\_ Г.В. Котрухов

\* Данный учебный план представлен в ознакомительных целях и не является официальным учебным планом, утверждённым и применяемым организацией